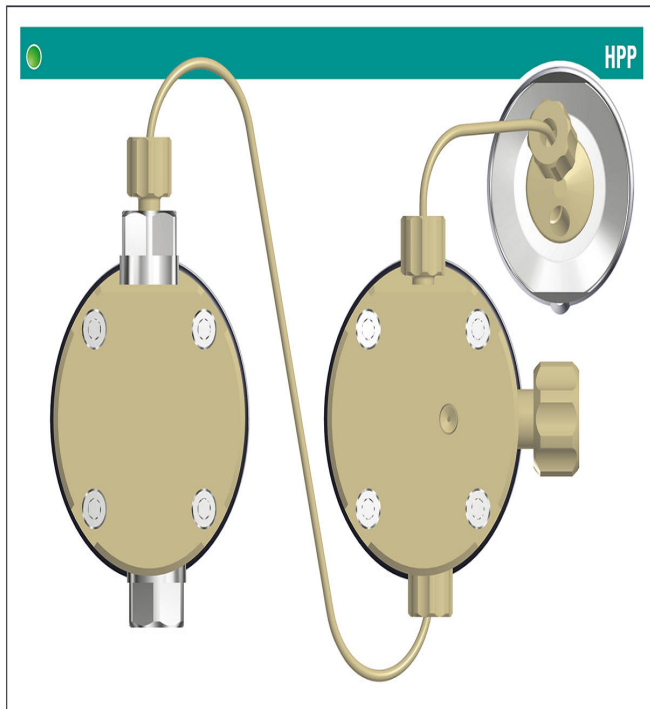




OMNIS High-Pressure Pump Unit

2.1056.0210

La OMNIS IC High-Pressure Pump Unit es una avanzada bomba de alta presión resistente a sustancias químicas que está diseñada específicamente para la cromatografía iónica.

Asegura un suministro de eluyentes controlado por pulsaciones en el que el volumen de suministro se compensa automáticamente, eliminando la necesidad de utilizar amortiguadores de pulsaciones adicionales. La carrera de la bomba se optimiza dinámicamente de acuerdo con las condiciones operativas, lo que garantiza un rendimiento óptimo. Cuenta con 2 accionamientos individuales sincronizados que permiten un control preciso y velocidades de flujo uniformes. El pistón está conectado al accionamiento, no al cabezal de la bomba, lo que mejora la estabilidad y simplifica el mantenimiento. La vía de flujo no contiene metales y es inerte químicamente, garantizando así la máxima compatibilidad con medios agresivos. Además, la bomba es resistente a sustancias en una extensa gama de valores de pH de 0 a 14, por lo que es adecuada para un amplio espectro de aplicaciones.

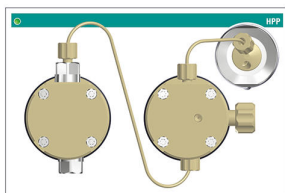
Opcionalmente, la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit puede equiparse con un elemento de lavado del sello del pistón para impedir la cristalización y minimizar la necesidad de mantenimiento. La OMNIS High-Pressure Pump Unit incluye una válvula de purga manual. Si se instala un inyector 7/3 en el OMNIS IC System, el proceso de purga puede automatizarse completamente.

Especificaciones:

- Gama de presión: 0–42 MPa
- Gama de flujo: 0,0001–10,000 mL/min
- Exactitud del flujo: 0,1%
- Reproducibilidad del flujo: 0,1%
- Pulsación: 0,1%
- Material del cabezal de la bomba: PEEK

Partes/accesorios 2.1056.0210

Order Number	Descripción	Cantidad
1.1056.0210	OMNIS High-Pressure Pump Unit La OMNIS IC High-Pressure Pump Unit es una bomba de alta presión avanzada y químicamente resistente, diseñada específicamente para la cromatografía iónica. Presenta un suministro de eluyentes controlado por pulsaciones, mediante el cual el volumen de suministro se compensa automáticamente, eliminando la necesidad de amortiguadores de pulsaciones adicionales. La carrera del pistón se optimiza dinámicamente según las condiciones de funcionamiento, garantizando un rendimiento óptimo. Dos accionamientos individuales sincronizados permiten un control preciso y caudales consistentes. El pistón está conectado al accionamiento en lugar de al cabezal de bomba, lo que mejora la estabilidad y simplifica el mantenimiento. La vía de flujo está libre de metales y es químicamente inerte, lo que garantiza la máxima compatibilidad con productos químicos agresivos. Además, la bomba es resistente a sustancias en una amplia gama de pH, de 0 a 14, lo que la hace adecuada para un gran espectro de aplicaciones. Opcionalmente, la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit puede equiparse con un lavado de sello para evitar la cristalización y minimizar el mantenimiento. La OMNIS High-Pressure Pump Unit incluye una válvula de purga manual. Si se instala un inyector 7/3 en el OMNIS IC System, el proceso de purga puede automatizarse por completo.	1 PCS



6.01831.110

Capilar PEEK HPP - INJ, 160/0,5 mm

1 PCS

Capilar PEEK previamente cortado con etiqueta de identificación para OMNIS IC



Accesorios opcionales

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



6.2821.120

Filtro inline 2 µm

Filtro inline 2 µm.



6.02621.010

Herramienta multiusos, HPP

Herramienta multifuncional para el mantenimiento de la OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.02741.000

Junta de pistón, PE, naranja

Junta de pistón para la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02741.030

**Kit de mantenimiento, junta
de lavado del pistón, 2 uds.**

Kit de mantenimiento para el lavado de sello de la OMNIS IC High-Pressure Pump Unit.



6.02824.000

**Pistón de la bomba, ZrO₂, 3,8
mm**

Pistón de la bomba de alta presión OMNIS IC.



6.02824.010

Válvula de entrada, PEEK

Válvula antirretorno sin metales para el lado de salida de la OMNIS IC High Pressure Pump Unit.



6.02824.020

Válvula de salida, PEEK

Válvula antirretorno sin metales para el lado de salida de la OMNIS High-Pressure Pump Unit.



6.05332.020

**Juego de accesorios OMNIS
IC: HPP lavado de sello, DD**



Set de accesorios para el lavado de junta de pistón HPP: el lavado de sello HPP para OMNIS IC HPP está previsto de forma estándar con un puerto libre en un sistema de dosificación en la OMNIS Cylinder Unit. Después de cada análisis de muestras, el pistón se enjuaga con una pequeña proporción de agua ultrapura.

Cuando no hay un canal libre disponible en la Cylinder Unit, el agua ultrapura se puede transferir alternativamente a través de un canal de bomba peristáltica equipado con tubo flexible de bomba peristáltica 601826010.

Requisitos:

OMNIS IC S/M/L, que incluye:

- puerto disponible en la OMNIS Cylinder Unit (con agua ultrapura como medio de trabajo) o
- canal disponible en la OMNIS Peristaltic Pump Unit

6.05801.010

Kit de lavado de sello



Kit de actualización para ampliar OMNIS High-Pressure Pump Unit con lavado de pistón. Se incluyen las juntas de retrolavado del pistón.

Requisitos:

- 2.1056.0210 OMNIS High Pressure Pump Unit
- 6.02621.010 herramienta multiusos, HPP